

ナノ・ライフ創新研究機構施設設備等(120-5号館)利用料金表

2017年4月1日改正②

2019年11月1日改正

早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構では、企業が共同研究・開発等で研究施設等を利用する場合、施設・装置の使用料として以下の利用料金を徴収する。

利用料金は、以下の料金表に基づき各々の費目の合計金額を請求する。

1. 施設使用料+2. 装置使用料+3. 材料費+4. 消耗品費+5. 技術指導料+6. 一般管理費+7. 消費税

1. 施設使用料

1-1. 入室料

入室者1名に対して、室内環境の維持整備費として以下の利用料を徴収する。

	実 験 室	料金 (円/日)	事 由
1	クリーンルーム (120-5号館B1F 001, 002, 027, 101室)	5,000 円/日	
2	機器室(120-5号館B1F 006, 007室)	1,000 円/日	
3	その他の実験室 [化学実験室など]	1,000 円/日	

2. 装置使用料等

利用料を徴収する装置は以下の表のとおり。(利用料は単価×利用時間)

なお、料金設定はメンテナンス費+光熱費+共通消耗品費を基礎に算定している。

設置場所	装 置	料金 (円/hr)	事 由
B1F(100)	マスクレスナノ構造形成装置 (EB描画2号機) EB-7700	11,000 円/hr	
B1F(100)	UV露光装置 (マスクアライナ)	1,250 円/hr	
B1F(10000)	3連電気炉	2,500 円/hr	
B1F(10000)	RTA/RTO	2,500 円/hr	
B1F(10000)	プラズマCVD(TEOS)	7,500 円/hr	
B1F(10000)	アトミックレイヤーデポジション (ALD) 装置	20,000 円/hr	
B1F(10000)	プラズマリアクター	2,500 円/hr	
B1F(10000)	新Deep-RIE	12,500 円/hr	
B1F(10000)	GCP-RIE	4,000 円/hr	
B1F(10000)	EB蒸着装置	5,000 円/hr	Au,Ptは貸出(有料)別途請求
B1F(10000)	EB蒸着装置(ANELVA)	5,000 円/hr	Au,Ptは貸出(有料)別途請求
B1F(10000)	分光エリブソメータ	4,000 円/hr	
BF-006	ESCA(1800MC)	5,000 円/hr	
BF-006	X線解析装置1 (GADDS)	5,000 円/hr	
BF-007	X線解析装置2(V)	5,000 円/hr	
BF-007	ミリング装置	7,500 円/hr	
BF-007	XeF2エッチング装置	7,500 円/hr	
BF-007	集束イオン/電子ビーム加工観察装置	16,000 円/hr	学外者の長時間使用の際は要相談
BF-007	ボンド用アライナーEVG620(ナノインプリント)	2,500 円/hr	
BF-007	卓上型精密研磨装置	2,500 円/hr	
BF-007	卓上SEM(Miniscopes)	2,500 円/hr	
BF-007	B1Fイオンコータ	2,500 円/hr	Au,Ptは貸出(有料)別途請求
BF-007	低温・ドライ還元装置	2,500 円/hr	
BF-007	FTIR	2,500 円/hr	
BF-007	イオンミリング(IM4000)	2,500 円/hr	
BF-007	FE-SEM(SU-8240)	9,000 円/hr	
BF-016	粒子および平板ゼータ電位測定装置	2,000 円/hr	
BF-027	分子間力プローブ顕微鏡システム (MFP-3D-10-OLY)	2,500 円/hr	
BF-027	エリブソメーター	2,500 円/hr	
BF-027	ナノ電子線描画装置システム EB-7500	11,000 円/hr	
BF-027	デジタルマイクロスコープ	2,000 円/hr	
BF-027	透過型電子顕微鏡	5,000 円/hr	
BF-027	電解放出型電子顕微鏡システム (S-5500)	7,500 円/hr	

1F-CR	スパッタ装置(SPF332H)	2,500 円/hr	
1F-CR	スパッタ装置 (SPC350)	5,000 円/hr	
1F-CR	スパッタ装置(SPF420L)	2,500 円/hr	
1F-CR	スパッタ装置 (SPF430H)	5,000 円/hr	Au,Ptは貸出(有料)別途請求
1F-CR	ICP-RIE	5,000 円/hr	
1F-CR	イオンビームスパッタ装置	7,500 円/hr	Au,Ptは貸出(有料)別途請求
1F-CR	精密メッキ装置	2,500 円/hr	
1F-CR	エキシマ照射装置1	2,500 円/hr	
1F-CR	エキシマ照射装置2	2,500 円/hr	
1F-CR	UVインプリント装置	2,500 円/hr	
1F-CR	デジタルマイクロスコープ	2,500 円/hr	
1F-CR	AFM装置(島津)	2,500 円/hr	
1F-CR	接触角計	2,500 円/hr	
1F-CR	大気圧プラズマ装置	2,500 円/hr	
1F-CR	簡易型真空バターニング治具	2,500 円/hr	
1F-CR	ロールtoロール微細転写装置	2,500 円/hr	
1F-CR	精密制御半導体基板アライメント装置 BA8Gen3	5,000 円/hr	
1F-CR	ウェハーボンダ SB6e	5,000 円/hr	
1F-CR	プラズマ活性化装置 PL8	2,500 円/hr	
2F-201	グロー放電装置(GDOES)	5,000 円/hr	
2F-201	走査プローブ顕微鏡	2,500 円/hr	
2F-201	量子干渉型SQUID磁束計	2,500 円/hr	
2F-201	触針式膜厚計tencor	2,500 円/hr	
2F-201	磁気光学測定装置(Kerr効果)	2,500 円/hr	
2F-201	AFM装置(ピーコ)	2,500 円/hr	
2F-201	極微細表面解析装置(顕微ラマン)	5,000 円/hr	
2F-202	電解メッキ装置 (NTE)	2,500 円/hr	
2F-202	分光光度計	2,500 円/hr	
2F-202	プラズマアッシャ	2,500 円/hr	
2F-202	CCD顕微鏡 (OMRON)	1,000 円/hr	
2F-202	分極測定装置HZ-5000(NTE)	2,500 円/hr	
2F-203	メッキ装置 (Au)	2,500 円/hr	
2F-203	メッキ装置 (Ni)	2,500 円/hr	
2F-203	メッキ装置 (Cu)	2,500 円/hr	
2F-203	CMP研磨システム-1(卓上用)	2,500 円/hr	
2F-203	CMP研磨システム-2	2,500 円/hr	
2F-203	純水生成装置	1,000 円/hr	
2F-204	蛍光観察装置	2,500 円/hr	
2F-204	SEM試料前処理装置	2,500 円/hr	
2F-204	生体分子分離・抽出・固定用実験機器一式	2,500 円/hr	
2F-204	FE-SEM(S-4800)	7,500 円/hr	
2F-204	薄膜物性評価装置	2,500 円/hr	
2F-204	2Fイオンコータ	2,500 円/hr	
2F-204	恒温槽	2,500 円/hr	
2F205A	超音波ボンダ	2,500 円/hr	
2F205A	ダイボンダ	2,500 円/hr	
2F205A	ダイシングソー (ディスコ)	2,500 円/hr	
2F205A	汎用SEM	3,750 円/hr	
2F205C	ナノデバイス評価装置(恒温ブローバ)	2,500 円/hr	
2F205C	半導体パラメータアナライザ	2,500 円/hr	
2F205C	ナノデバイス評価装置(マイクロブローバ)	2,500 円/hr	
2F206B	真空乾燥デシケータ	2,500 円/hr	
2F206B	真空低温乾燥器	2,500 円/hr	
2F206G	ICP-MS	12,500 円/hr	Arガス代を含む
3F (303)	高耐圧デバイス測定装置システム	7,500 円/hr	
3F (303)	半導体パラメータアナライザ(4200-SCS)	2,500 円/hr	
3F (303)	高周波測定装置	2,500 円/hr	
3F (303)	半導体パラメータアナライザ(B1500A)	2,500 円/hr	

3. 材料費

種 別	内 容	単価(単位)		備 考
基板	Siウエハー(4インチ)、ガラス基板(4インチ)、	時価	円/枚	購入時の原価から算出
	標準マスク材料	時価	円/枚	購入時の原価から算出
	デバイス材料	時価	円/個	購入時の原価から算出

4. 消耗品費

種 別	内 容	単価(単位)		備 考
一 般	有機試薬、高圧ガス、貴金属試薬、特殊ガス、レジスト等	時価	円/式	プロセスに必要なものとして必要により徴収する
スパッタ材料	貴金属 Au、Pt等	時価	円/g	使用量×購入単価
蒸着材料	貴金属 Au、Pt等	時価	円/g	使用量×購入単価

5. 技術指導料

機構に所属する研究者等が実施する実習、装置トレーニング、デバイス作製、データー測定・解析・評価、情報提供等に関して

以下の技術指導料を徴収する。

	種別	資格	単価(単位)		単価(円/日)	事 由
1	A	教授・准教授	7,000	円/hr	56,000 円/日	
2	B	講師・助教	6,000	円/hr	48,000 円/日	
3	C	研究助手(40歳以上)	5,000	円/hr	40,000 円/日	
4	D	研究助手・PD	4,000	円/hr	32,000 円/日	
5	E	大学院生	2,500	円/hr	20,000 円/日	

6. 自主事業

自主事業(成果非公開)の装置使用料は、大学、公的機関、企業を問わず、通常の企業の装置使用料の2倍とする。

7. 一般管理費

早稲田大学内における事務処理経費として上記 1. 施設利用料、2. 装置利用料、3. 材料費、4. 消耗品費、5. 技術指導料の合計額の20%を徴収する。

8. 消費税

1. 施設利用料、2. 装置利用料、3. 材料費、4. 消耗品費、5. 技術指導料、6. 一般管理費の合計額に対する消費税を徴収する。